



2012年9月

ISSM 組織委員会委員長

株式会社東芝 取締役 代表執行役副社長 斎藤 昇三

ISSM 組織委員会副委員長

東北大学 未来科学技術共同研究センター シニアリサーチフェロー 名誉教授 大見 忠弘

ISSM 運営委員会委員長

ルネサスエレクトロニクス株式会社 生産本部プロセス技術統括部 統括部長 井上 修一

第20回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2012」 協賛(スポンサーシップ)のお願いについて

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は皆様のご支援を賜り、これまでの19回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議としての認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立することができました。ISSM のテーマである半導体製造技術は、「作る技術」から「使う技術」へのシフトが益々重要となってきております。半導体製造技術全体を広く捉えて技術を評価し選択していくことが必要な今、ISSM は半導体製造全般の技術を網羅している特徴を活かし、異なる技術分野を統合化する体系的なアプローチを評価できる唯一の国際会議としてISSM は半導体製造の発展に一層寄与していきたいと考えます。

本シンポジウムは、半導体産業の健全かつ永続的な発展にむけて、国際的な協調を図りつつ、21世紀の高度情報通信社会やユビキタス・ネットワーク社会を担うための、次世代半導体生産技術の確立と高度化に資することを目的としております。

ISSM2012 は、2012年10月15日(月)～17日(水)に、ハイアットリージェンシー東京での開催を予定しております。従来にも増し、運営体制もアジア地域を含めた国際連携を強固にし半導体生産技術の革新的な挑戦を世界の技術者が論議しあう場を提供します。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費設定も必要と考えております。我が国の会議場費の高コスト構造などの事情を勘案しますと、経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2012 に何卒、ご支援を頂きたく、ご協賛(スポンサーシップ)にご協力賜りたく、ご高配のほどよろしくお願ひ申し上げます。

敬 具

ISSM2012

2012年10月15日(月)～17日(水)
ハイアットリージェンシー東京(新宿)開催予定

開催趣意書

Version 1.2

ISSM2012 開催趣旨

半導体産業は極めて大きな変革期に入っています。とくにこれまで長年半導体の推進役を果たしてきた“微細化技術”のトレンドに翳りが見え始め、今後は“微細化技術”に加えて、これからのネットワーク社会を支える中核技術としての新たな半導体デバイスを実現するために、新しい“半導体生産技術”の体系を構築することに大きな期待がかけられています。

“垂直統合”から“水平分業”へという産業構造の大きな変化と共に、成熟期“300mm”生産ラインのさらなる効率化、あるいは450mm次世代ウエハーサイズへの移行、デバイスの三次元化などの生産コスト削減やサイクルタイム削減などの動きは、「半導体産業の在り方」がその「生産性」をめぐって大きな転換期に入っていることを象徴しています。このような半導体産業の新たな発展の時代にあっては、「高品質、低コスト、高効率」の“半導体生産技術”が、競争力の要となると考えられます。さらに、その生産技術は、地球環境への配慮が強く求められています。

しかし、半導体の生産技術は、永らく「経験とノウハウの蓄積」に留まってきた経緯があり、「技術としての体系化、普遍化」は十分とは言い難く、半導体の生産技術にブレークスルーをもたらし、時代の要請にこたえてゆくために、1992年よりISSM (International Symposium on Semiconductor Manufacturing) をスタート致しました。それ以来、ISSMは半導体の生産技術を、体系化、普遍化された技術体系として構築すること、すなわち「ノウハウをサイエンスに」することを目指して開催して参りました。その結果、新たな半導体生産技術の芽を育てると共に「生産技術のサイエンス化」という新しい流れを作りだしました。しかし、その道は未だ半ばであり、21世紀における半導体産業の再躍進を牽引する新たな生産技術革新へ向けて一層の強化が不可欠です。

ISSMは、(応用物理学会)、米国のIEEE EDS、半導体製造装置・材料の国際的な工業会であるSEMI、この三者の共催の下に、1992年より日米で交互に毎年開催されてきた会議です。(応用物理学会は、2000年より半導体基盤技術研究会(UCS)を後継) 産業界や大学において、広く半導体の生産技術に関わる研究者、技術者が一堂に会し、

- 1) グローバリズムに立脚し
- 2) 技術の高度化への絶えざる挑戦を試み
- 3) 開発した技術を世に問い批判を仰ぐ

ことを基本スタンスとして、半導体の生産技術を発表、論議し、そして、技術者相互の交流と啓発、切磋琢磨を図って参りたいと念じております。これらにより、半導体の生産技術の強化と高度化の実現、延いては半導体産業の永続的な繁栄に資することを目的としております。

「半導体産業の研究開発に携わる技術者ならびに生産現場の技術者が一体となって、半導体の生産技術にブレークスルーをもたらし、半導体産業の永続的な繁栄を目指す」この試みに対し、関係各位のご理解とご協力、ならびに、研究開発と生産に関わる技術者、とくに次世代の半導体産業を担おうとする若手技術者の積極的な参加を強く期待します。

ISSM2012 大綱

1. 会議の名称

(和文名称) 第 20 回半導体生産技術国際シンポジウム

(英文名称) 20th International Symposium on Semiconductor Manufacturing

(略 称) ISSM2012

2. 主催機関などの名称

(主催) JSAP 応用物理学会

IEEE EDS

SEMI

3. 会期と開催地(予定)

(1)会 期:2012 年 10 月 15 日(月)ー17 日(水)

(2)開催地:ハイアットリージェンシー東京(東京都新宿区)

4. 会議の性格と目的

「開催趣旨」のとおり

5. 経過と開催の意義

ISSM は、第 1 回を ISSMT'92 として日本で開催して以来、日米交互開催を実現して参りました。2009 年は欧州において他会議との併催が検討されましたが、経済情勢を鑑み開催中止となり、2010 年は 18 回目を日本にて開催、2011 年は台湾にて e-Manufacturing & Design Collaboration Symposium 2011 –A joint Symposium with ISSM2011-として開催、本年は 20 回目の半導体生産技術国際会議となります。半導体生産技術に関わる議論は、共通の課題に対して半導体産業界が協調して取り組む姿勢に大きく変わりつつあります。半導体生産技術に関わる真摯な議論を継続して行ってきた国際会議「ISSM」の活動の意義は誠に大きいと言えます。

ISSM の試みは、“ノウハウをサイエンスに”を目指して、広く半導体生産技術に関わる技術者が一堂に会し、

1) グローバリズムに立脚し

2) 技術の高度化への絶えざる挑戦を試み

3) 開発した技術を世に問い議論をふかめ、さらにより良い成果を与える

を基本スタンスとして、半導体生産技術を発表、論議して参りました。また ISSM は技術者相互の交流と啓発、切磋琢磨を通じて、半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを目指そうとするものです。

「ISSM」は、UCS(半導体基盤技術研究会)がその草創を担い、その後、日本側では UCS、米国側では SEMI および IEEE EDS という、三者が国際会議としての立ち上げ定着を行いました。UCS の活動終了(2000 年度をもって満了)に伴い、替わって日本側主催団体は 2002 年以降、応用物理学会となっております。ISSM では関連研究者・技術者をさらに強力に糾合し、21 世紀の半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資することを目的として、ISSM2012 を開催致します。

1. ISSM2012 会議の概要

(ア) 会議日程 2012 年 10 月 15 日(月)－17 日(水)

(イ) 会議内容(予定)

① キーノートセッション(基調講演)

ノーベル物理学賞受賞者 江崎 玲於奈氏

株式会社東芝 取締役 代表執行役副社長 齋藤 昇三氏

サムスン電子株式会社 上席アドバイザー 李 潤雨氏 (Yoon Woo Lee 氏)

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 生産・技術本部長兼、会津工場長

五十嵐静雄氏

Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology IISB
Head of Business Unit Semiconductor Manufacturing Equipment and
Methods Prof. Dr. Lothar Pfitzner 他

<招待講演>モレキュラー・インプリンツ・インク 代表 溝上 裕夫氏

② オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)

③ インターラクティブ・ポスターセッション

④ ネットワーキングセッション(ブース出展)

(ウ) 会議の主題(暫定):半導体生産技術

① Fab Management

- ・ 工場設計および搬送自動化(FD)
- ・ 製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
- ・ 生産管理および制御(MC)
- ・ 環境・安全・健康(ES)

② Process Integration

- ・ プロセスおよび材料の最適化(PO)
- ・ 歩留まり向上(YE)
- ・ 汚染防止及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
- ・ プロセス制御・モニタリング(PC)
- ・ 製造装置・測定装置(PE)
- ・ 生産性設計(DM)

③ Final Manufacturing

- ・ ファイナル・マニュファクチャリング(FM)

(エ) ISSM2012 のハイライト・テーマ

現在注目の技術に関しては、採択論文決定後にハイライト・テーマとしてそれらを含め、エリアを横断的にカバーする別セッションとしてプログラムを構成します。

- ・ 3DIC (TSV and all other 3D)
- ・ Printed Electronics (プリントド・エレクトロニクス)
- ・ Process Control Solution (プロセス制御 セスセス制御ソリューション)
- ・ Business Continuity Plan/Management (BCP/BCM)
(事業継続計画－震災対応・リスクマネジメント(BCP))
- ・ Power Devices (パワー半導体)

(オ) 参加予定国:日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

(カ) 参加予定者

日本、欧米、アジアなどから 250 名

(キ) 会議公用語

講演

英語、

印刷物

英語

October 15-17, 2012
Hyatt Regency Tokyo



ISSM 2012 スポンサー(協賛)様へのご提供内容

	Executive エグゼクティブ スポンサー	Platinum プラチナ スポンサー	Gold ゴールド スポンサー	Silver シルバー スポンサー	Bronze ブロンズ スポンサー
Sponsorship amount	¥800,000	¥560,000	¥400,000	¥240,000	¥80,000
スポンサー合計額	¥800,000	¥560,000	¥400,000	¥240,000	¥80,000
口数(一口8万円)	10	7	5	3	1
ISSM 2012 Website					
ISSM 2012 Website ウェブサイト					
Company logo placed on homepage	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ホームページでのスポンサーカンパニーロゴの記載	有	有	有	有	有
Link to company homepage	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
スポンサーカンパニーホームページへのリンク	有	有	有	有	有
ISSM 2012 Proceedings storage(USB) & Brochure					
ISSM 2012 予稿集ストレージ(USB予定)、当日配布資料					
Recognition of sponsorship in meeting materials along with company name and link to corporate website (User would need to have Internet access when viewing through storage)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
会議資料におけるスポンサーカンパニーの表示とスポンサーカンパニーホームページへのリンク(ストレージからの視聴の際は要インターネット接続)	有	有	有	有	有
ISSM 2012 Screen at site					
ISSM 2012 会場でのご広告					
Company logo on the screen of interval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
スクリーン上にスポンサーカンパニーロゴを表示	有	有	有	有	有
Company logo poster at the Symposium Room	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
会場にスポンサーカンパニーロゴポスターを掲示	有	有	有	有	有

ISSM事務局
株式会社セミコンダクタポータル内
〒107-0052
東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館17F
Tel:03-3560-3565 Fax: 03-3560-3566
issm_2012@semiconportal.com

ISSM2012 委員会組織(敬称略)

組織委員会

ISSM組織委員会				
委員長	齋藤 昇三	(株)東芝		取締役 代表執行役副社長
副委員長	大見 忠弘	東北大学	未来科学技術共同研究センター	シニアリサーチフェロー、名誉教授
	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン(株)		技師長
	伊藤 義武	オムロン(株)	マイクロデバイス事業部 生産技術部	部長
	井上 道弘	(独)産業技術総合研究所	九州産学官連携センター	イノベーションコーディネータ
	内田 博文	大日本スクリーン製造(株)	半導体機器カンパニー	カンパニー副社長
	貝塚 考亘	東京エレクトロン(株)	先端プロセス開発センター	センター長
	依田 孝	(株)東芝	セミコンダクター&ストレージ社	生産性改善推進部 担当部長
	海本 博之	パナソニック(株)	デバイス社 半導体事業グループ マニファクチャリング統括部 プロセス開発センター	センター所長
	八木 春良	富士通セミコンダクター(株)		取締役 執行役員副社長
	鶴丸 哲哉	ルネサスエレクトロニクス(株)		取締役執行役員 兼 生産本部本部長
	井上 修一	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部・プロセス技術統括部	統括部長
	西村 正	東京工業大学大学院	理工学研究科電気電子専攻	連携教授、工学博士
	山葉 隆久	ローム(株)	常務取締役 生産統括本部	本部長
アドバイザーボード	川西 剛	TEKコンサルティング		代表
アドバイザーボード	佐々木 元	日本電気(株)		特別顧問
アドバイザーボード	伊藤 達			
アドバイザーボード	塚本 克博	三菱電機(株)		顧問

運営委員会

ISSM運営委員会				
委員長	井上 修一	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部・プロセス技術統括部	統括部長
副委員長	平山 誠	State University of New York	College of Nanoscale Science and Engineering	Professor
	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン(株)		技師長
	北野 直樹	インテル(株)	技術開発・製造技術本部	技術戦略担当部長
	清水 正男	オムロン(株)	マイクロデバイス事業部	技術専門職 工学博士
	南 敦馬	セイコーエプソン(株)	半導体事業部 IC製品部	部長
	中川 洋一	SEMIジャパン		代表
	内田 博文	大日本スクリーン製造(株)	半導体機器カンパニー	カンパニー副社長
	売賀 賢介	(株)デュラシステムズ		代表取締役社長
	服部 毅	電子ジャーナル		編集顧問
	貝塚 考亘	東京エレクトロン(株)	先端プロセス開発センター	センター長
	依田 孝	(株)東芝	セミコンダクター&ストレージ社 生産性改善推進部	担当部長
	常松 政義	(社)日本半導体製造装置協会		専務理事
	海本 博之	パナソニック(株)	生産本部 プロセス開発センター	所長
	上田 潤	(一社)半導体産業研究所		部長
	前川 耕司	PDFソリューションズ(株)	Japan Business Development	Vice President
	中馬 宏之	一橋大学	イノベーション研究センター	教授
	羽入 勇	富士通セミコンダクター(株)	デバイス開発統括部	主席部長
	神澤 公	ローム(株)	研究開発本部	副本部長

プログラム委員会

プログラム委員会			
委員長	内野 敏幸	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 生産計画統括部 アウトソース計画部 担当部長
委員長代行	嶋崎 綾子	(株)東芝	セミコンダクター&ストレージ社 半導体研究開発センターAU開発試作部評価解析 担当 評価解析技術開発主幹
副委員長	小池 英敏	東芝マイクロエレクトロニクス(株)	イメージセンサ製品技術部 イメージセンサ製品技術第一担当 グループマネージャー
副委員長	今井 清隆	ケーエルエーテンコール(株)	ディフェクト・ソリューション技術本部 本部長
幹事会委員	加藤 凡典	(有) エー・アイ・ティ	代表取締役
幹事会委員	小澤 克敏	オムロン(株)	ものづくり革新本部 基盤技術支援センタ 管理技術推進グループ 主幹
幹事会委員	南百瀬 勇	セイコーエプソン(株)	技術開発本部 生産技術センター 副主幹
幹事会委員	今井 伸一	パナソニック(株)	本社R&D部門 先行デバイス開発センター 主幹技師
	水野 晋介	アプライドマテリアルズジャパン(株)	PDGプロダクトマネージメント マネージャー
	赤石 実	三洋半導体(株)	技術統括部 プロセス技術開発部 担当課長
	新保 正博	三洋半導体(株)	技術統括部 プロセス技術開発部 主任技術員
	三宅 賢治	株式会社ピーエムティー	経営企画室 室長
	久保 光輝	ソニーセミコンダクタ(株)	生産技術部門 FAシステム1部 プロセス制御技術課
	斉藤 美佐子	東京エレクトロン(株)	技術開発センター コンタミ制御グループ グループリーダー
	矢島 比呂海	(株)東芝	デバイスプロセス開発センター 企画・半導体技術担当
	江崎 裕治	日本テキサス・インスツルメンツ(株)	DISP製品部/半導体グループ 上級主任技師
	西谷 英輔	(株)日立国際電気	研究開発本部 半導体装置システム研究所 主管研究員
	渡辺 健二	(株)日立ハイテクノロジーズ	ナノテクノロジー製品事業本部 那珂事業所 那珂アプリケーションセンタ センタ長
	名村 至	富士通セミコンダクター(株)	プロセス技術統括部プロセス技術部 担当部長
	安井 孝俊	パナソニック(株)	セミコンダクター社 生産本部 プロセス開発センター 主幹技師
	秋元 健司	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 プロセス技術統括部 プロセス加工技術部 主管技師
	岩田 義雄	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 那珂工場 IT/CIM部 部長
	片山 俊治	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 デバイス・解析技術統括部 解析評価技術部 主任技師
	横田 和樹	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 プロセス技術統括部 プロセス加工技術部 量産リソグラフィ技術課 課長
	山本 悦章	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 プロセス技術統括部 プロセスモジュール技術部 スパッタ技術課 課長
	奥 良彰	ローム(株)	新材料デバイス研究開発センター 技術主査
	小町 恭一	ローム(株)	

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー東館 17F

Tel : 03-3560-3565, Fax : 03-3560-3566, E-mail : issm_2012@semiconportal.com